

Busta 3

D1. Il candidato descriva un processo per la fabbricazione di un dispositivo micro/nanostrutturato, dalla pulizia del wafer alla caratterizzazione del device.

D2. Il candidato descriva un set-up di misura per la caratterizzazione elettrica, in condizioni criogeniche (temperatura dell'azoto liquido/elio liquido, $T \ll 77\text{K}$), di dispositivi micro e nanostrutturati.

D3. Il candidato elenchi e descriva gli impianti accessori necessari per il corretto funzionamento di uno strumento di deposizione da installare all'interno di un ambiente a controllo particellare (Cleanroom).